

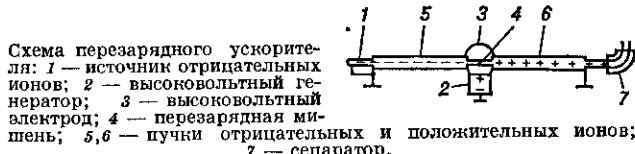
к-рой положит. ион захватывает два электрона, превращаясь в отрицат. ион. П. и. возможна вблизи поверхности металла. При этом ион нейтрализуется электроном металла.

П. и. играет существ. роль в балансе частиц высокотемпературной плазмы; определяет торможение пучка атомов, инжектированных в плазму того же элемента, подвижность ионов в собств. газе, свойства газоразрядной плазмы, созданной в атомном газе, и т. д.

Лит.: М о тт Н., М есси Г., Теория атомных столкновений, пер. с англ., [3 изд.], М., 1969; Н икитин Е. Е., Смирнов Б. М., Медленные атомные столкновения, М., 1990.

Б. М. Смирнов.

ПЕРЕЗАРЯДНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ (тандем) — высоковольтный ускоритель, в к-ром благодаря перезарядке ускоряемых частиц (изменению знака, а иногда и величины заряда) одно и то же ускоряющее напряжение применяется дважды: отрицат. ионы ускоряются при движении к положительно заряженному высоковольтному электроду, а положит. ионы, образовавшиеся после перезарядки, — при движении от него к электроду с



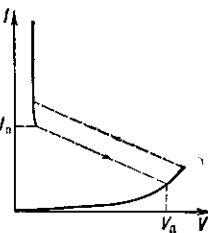
нулевым потенциалом. Использование перезарядки позволяет при том же напряжении генератора увеличить энергию протонов вдвое, а энергию более тяжелых частиц в неск. раз. При этом облегчается питание и обслуживание ионного источника, к-рый находится под нулевым потенциалом. Образующиеся после перезарядки частицы с разл. зарядами ускоряются до разных энергий, поэтому для их разделения после ускорения необходима сепарация, осуществляемая магнитом с полем, перпендикулярным направлению движения частиц. Энергия частиц на выходе П. у. равна $\mathcal{E} = eU(n_- + n_+)$, где U — напряжение высоковольтного генератора, n_- и n_+ — заряды частиц до и после перезарядки (обычно $n_- = 1$). Добавление еще одного генератора с отрицат. полярностью напряжения (в ой и ой та идем) повышает энергию частиц до $\mathcal{E} = eU(2n_- + n_+)$. Типичные величины напряжений, применяемых в П. у., ~10–20 МВ, в наиб. крупных П. у. — 25–30 МВ.

Идея использовать перезарядку для увеличения энергии ускоряемых частиц предложена У. Х. Беннеттом (W. H. Bennett) в 1935, однако она была реализована лишь в 1958 после разработки эф. источников отрицат. ионов и перезарядных устройств — мишеней. Перезарядная мишень представляет собой трубку, в к-рую подается газ, или плёнку твёрдого вещества (углерода) толщиной неск. мкг/см². Применение твёрдых мишеней позволяет получить положит. ионы тяжелых элементов с более высокой зарядностью ($n_+ = 7–10$). Для дополнит. обидки ионов после перезарядки на одном из участков ускорит. тракта может быть установлена еще одна мишень.

Лит.: Комар Е. Г., Основы ускорительной техники, М., 1975; «Nuclear Instruments and Methods», 1974, v. 122, № 1/2 (спец. выпуск). М. П. Смирнов.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЭФФЕКТЫ — скачкообразный обратимый переход полупроводника (или полупроводниковой структуры) из высокоомного состояния в низкоомное под действием электрич. поля, превышающего пороговое значение $E_p = 10^4–10^6$ В/см. П. э. наблюдаются в полупроводниках, у к-рых вольт-амперная характеристика (ВАХ) имеет участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Такой характер ВАХ обусловлен формированием электрич. доменов (для ВАХ N-типа; см. Ганна эффект, Ганна диод) или токовых шнурков (для ВАХ S-типа; см. Шнурование тока).

Термин «переключение» возник в связи с обнаружением быстрого (10^{-11} с) и большого (4-го порядка) изменения проводимости халькогенидных стеклообразных полупроводников (ХСП) сложного состава (рис.). П. э. в ХСП впервые наблюдалась в 1961–62 А. Д. Пирсоном (A. D. Pearson), Б. Т. Коннором (B. T. Connor).



Вольт-амперная характеристика халькогенидных стеклообразных полупроводников: I — сила тока; V — напряжение.

ломийцем, С. Р. Овшинским (патент США, 1963). В патентной литературе П. э. в ХСП наз. эфектом Овшинского (см. Аморфные и стеклообразные полупроводники).

В плёнках ХСП с двумя металлич. электродами П. э. наблюдаются при постоянном, переменном и импульсном напряжении. Пороговые ток I_p и напряжение V_p не зависят от полярности напряжения, а также от темп-ры T в диапазоне 2–250 К; при повышении T они претерпевают скачок: I_p возрастает, напряжение падает и затем слабо изменяется с T , вплоть до размягчения материала. Аналогично зависит I_p и V_p от длительности импульса напряжения V , и скачок параметров наблюдается при длительности импульсов, близкой ко времени диэлектрич. релаксации материала. В зависимости от амплитуды импульсов переключение может возникнуть как на переднем фронте импульса (длительность 50 пс), так и с задержкой. В последнем случае в образце формируется канал, в к-ром пороговые условия реализуются раньше, чем в остальной части образца. Трансформация канала в токовый шнур происходит скачком, когда канал теряет флуктуацию, устойчивость (см. Флуктуации электрические), а плотность тока вне канала достигает критич. величины. Если плотность тока вне канала не достигает критич. величины, преобразование канала в шнур происходит плавно (П. э. «вырождается»).

Дифференц. сопротивление образца с токовым шнуром близко к 0. Плотность тока в шнуре «насыщается» при величине порядка $\sim 10^4$ А/см². Сечение шнуря практически линейно зависит от тока. Время восстановления пороговых параметров после снятия напряжения определяется восстановлением однородности образца и является линейной ф-цией расстояния между электродами. Для образцов длиной $\sim 0,5$ мкм и сечением 10^{-10} см² это время сравнимо со временем переключения. Энергия, затрачиваемая на переключение таких образцов, может достигать 10–15 Дж при $T = 300$ К. Уменьшение V_p в течение первых переключений обусловлено несовершенством стеклообразных плёнок и контактов.

В кристаллич. полупроводниках с S-образной ВАХ (при одинаковых с ХСП параметрах) П. э. отсутствуют. Поэтому механизмы П. э. в ХСП связывают с влиянием разупорядочения. Однозначно механизм П. э. в ХСП не установлен.

Практически неограниченное число переключений ($>10^{14}$) и стойкость ко всем видам внешн. воздействий, а также возможность управления фазовыми трансформациями в токовом шнуре (кристаллизация) обеспечивают использование П. э. в стабилизаторах напряжения, для защиты интегральных схем от перенапряжения, в переключателях СВЧ-сигналов, в датчиках давления и темп-ры, генераторах сигналов спец. формы, операц. усилителях и т. п.

Лит.: Костылев С. А., Шкут В. А., Электронное переключение в аморфных полупроводниках, К., 1978; A. D. Pearson, H. K. Mott, The mechanism of threshold switching in amorphous alloys, «Rev. Mod. Phys.», 1978, v. 50, p. 209; M. Dan A., Shaw M. P., The physics and applications of amorphous semiconductors, Boston—[a.o.], 1988. В. Б. Сандомирский.